

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2007 年 10 月 25 日 (25.10.2007)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2007/119875 A1

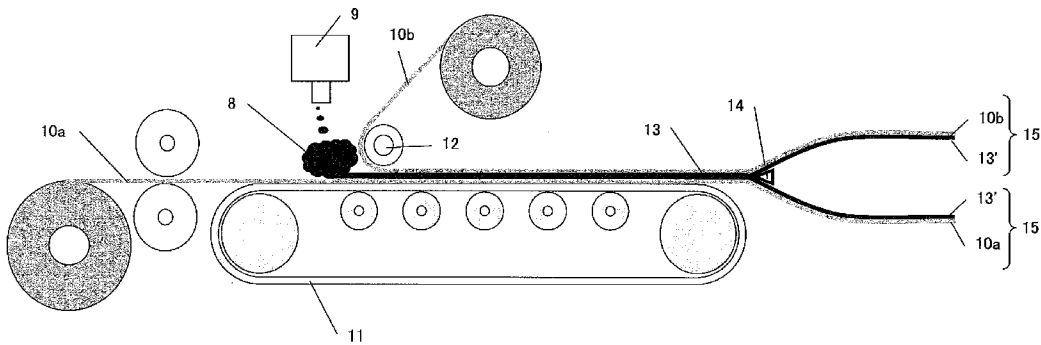
- (51) 国際特許分類:
B24B 37/00 (2006.01) H01L 21/304 (2006.01)
C08J 5/14 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2007/058493
- (22) 国際出願日: 2007 年 4 月 19 日 (19.04.2007)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2006-115890 2006 年 4 月 19 日 (19.04.2006) JP
特願2006-115897 2006 年 4 月 19 日 (19.04.2006) JP
特願2006-115904 2006 年 4 月 19 日 (19.04.2006) JP
特願2006-115907 2006 年 4 月 19 日 (19.04.2006) JP
特願2007-088388 2007 年 3 月 29 日 (29.03.2007) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東洋ゴム工業株式会社 (TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 1 7 番 1 8 号 Osaka (JP).

- (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 福田 武司 (FUKUDA, Takeshi) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 1 7 番 1 8 号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP). 渡邊 二夫 (WATANABE, Tsuguo) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 1 7 番 1 8 号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP). 廣瀬 純司 (HIROSE, Junji) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 1 7 番 1 8 号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP). 中村 賢治 (NAKAMURA, Kenji) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 1 7 番 1 8 号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP). 堂浦 真人 (DOURA, Masato) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 1 7 番 1 8 号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 尾崎 雄三, 外 (OZAKI, Yuzo et al.); 〒5320011 大阪府大阪市淀川区西中島 5 丁目 1 3-9 新大阪 MT ビル 1 号館 Osaka (JP).

[続葉有]

(54) Title: METHOD FOR MANUFACTURING POLISHING PAD

(54) 発明の名称: 研磨パッドの製造方法



(57) Abstract: Provided is a method for manufacturing a polishing pad with a reduced number of manufacturing steps and excellent productivity. A method for manufacturing a laminated polishing pad with a reduced number of manufacturing steps and excellent productivity without peeling between a polishing layer and a cushion layer is also provided. The method for manufacturing the polishing pad includes a step of preparing a bubble dispersed urethane composition by machine foaming method; a step of continuously discharging the bubble dispersed urethane composition on a face material, while feeding the face material; a step of laminating another face material on the bubble dispersed urethane composition; a step of forming a polishing layer composed of a polyurethane foam by hardening the bubble dispersed urethane composition, while adjusting the thickness uniform; a step of manufacturing two long polishing layers composed of the polishing layer and the face material at the same time by cutting the polishing layer into two in parallel to the face; and a step of cutting the long polishing layers.

(57) 要約: 製造工程が少なく、生産性に優れる研磨パッドの製造方法を提供することを目的とする。また、製造工程が少なく、生産性に優れ、研磨層とクッション層との間で剥離することがない積層研磨パッドの製造方法を提供することを目的とする。本発明の研磨パッドの製造方法は、機械発泡法により気泡分散ウレタン組成物を調製する工程、面材を送り出しつつその上に気泡分散ウレタン組成物を連続的に吐出する工程、該気泡分散ウレタン組成物上に別の面材を積層する工程、厚さを均一に調整しつつ気泡分散ウレタン組成物を硬化させることによりポリウレタン発泡体からなる研磨層を形成する工程、該研磨層を面に対して平行に2つに切断することにより、研磨層と面材からなる長尺研磨層を2枚同時に作製する工程、及び長尺研磨層を裁断する工程を含む。

WO 2007/119875 A1



(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。